

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第3部門第2区分

【発行日】令和2年4月16日(2020.4.16)

【公表番号】特表2018-504394(P2018-504394A)

【公表日】平成30年2月15日(2018.2.15)

【年通号数】公開・登録公報2018-006

【出願番号】特願2017-534608(P2017-534608)

【国際特許分類】

C 07 F 7/22 (2006.01)

【F I】

C 07 F 7/22 E

【誤訳訂正書】

【提出日】令和2年3月2日(2020.3.2)

【誤訳訂正1】

【訂正対象書類名】特許請求の範囲

【訂正対象項目名】全文

【訂正方法】変更

【訂正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

0.3%未満のレベルの二塩化ジオクチルスズ及び0.1%未満のレベルの塩化トリオクチルスズを含む三塩化モノオクチルスズを製造する方法であって、前記方法が、以下の工程：

(1) 塩化モノオクチルスズを含み、ジオクチルスズ化合物及び/又はトリオクチルスズ化合物を含む塩化有機スズの混合物を、ハロゲン化物塩を含有する水相に接触させる工程であって、前記工程が、任意選択的に、有機溶媒の存在下で実施され、塩化モノオクチルスズを含む水相と、ジオクチルスズ化合物及び/又はトリオクチルスズ化合物の殆どを含有する有機相を得る工程；

(2) 前記水相を、前記有機相から分離する工程；

(3) 前記水相を有機溶媒で洗浄することにより、望ましくない副生成物から前記水相を精製する工程；及び

(4) 前記水相から三塩化モノオクチルスズを回収する工程、
を含む、方法

【請求項2】

前記塩化有機スズの混合物を、ハロゲン化物塩を含有する水相に接触させる工程(1)
が有機溶媒の存在下で実施される、請求項1に記載の方法。

【請求項3】

前記塩化有機スズの混合物を、ハロゲン化物塩を含有する水相に接触させる工程(1)
で使用される前記有機溶媒がn-ヘキサン、n-ヘプタン及びジ-n-ブチルエーテルからなる群から選択される、請求項1又は2に記載の方法。

【請求項4】

前記水相を洗浄する工程(3)で使用される前記有機溶媒が、n-ヘキサン及びn-ヘ
プタンからなる群から選択される、請求項1に記載の方法。

【請求項5】

前記水相を洗浄する工程(3)で使用される前記有機溶媒が、n-ヘキサン及びn-ヘ
プタンからなる群から選択される、請求項2に記載の方法。

【請求項6】

前記水相を洗浄する工程(3)で使用される前記有機溶媒が、n-ヘキサン及びn-ヘ

プタンからなる群から選択される、請求項 3 に記載の方法。

【請求項 7】

前記塩化有機スズの混合物を、ハロゲン化物塩を含有する水相に接触させる工程（1）が、20から50 の温度で実施される、請求項 1 に記載の方法。

【請求項 8】

前記塩化有機スズの混合物を、有機溶媒の存在下で、ハロゲン化物塩を含有する水相に接触させる工程（1）が、20から50 の温度で実施される、請求項 2 に記載の方法。

【請求項 9】

前記塩化有機スズの混合物を、n - ヘキサン、n - ヘプタン及びジ - n - ブチルエーテルからなる群から選択される有機溶媒の存在下で、ハロゲン化物塩を含有する水相に接触させる工程（1）が、20から50 の温度で実施される、請求項 3 に記載の方法。

【請求項 10】

前記塩化有機スズの混合物を、ハロゲン化物塩を含有する水相に接触させる工程（1）が、20から50 の温度で実施される、請求項 4 に記載の方法。

【請求項 11】

前記水相を有機溶媒で洗浄する工程（3）が、20から50 の温度で実施される、請求項 1 に記載の方法。

【請求項 12】

前記水相を有機溶媒で洗浄する工程（3）が、20から50 の温度で実施される、請求項 10 に記載の方法。

【請求項 13】

前記水相を有機溶媒で洗浄する工程（3）が、20から50 の温度で実施される、請求項 2 に記載の方法。

【請求項 14】

前記塩化有機スズの混合物を、n - ヘキサン、n - ヘプタン及びジ - n - ブチルエーテルからなる群から選択される有機溶媒の存在下で、ハロゲン化物塩を含有する水相に接触させる工程（1）が、20から50 の温度で実施される、請求項 6 に記載の方法。

【請求項 15】

前記水相を有機溶媒で洗浄する工程（3）が、20から50 の温度で実施される、請求項 14 に記載の方法。